

2019年度 第5回 ナノファブスクエア in 海老名 講習・実習会

ナノパターン形成

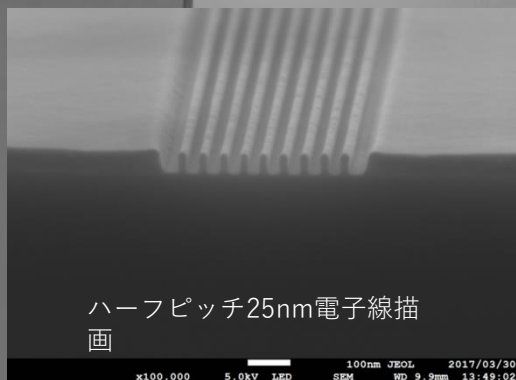


川崎市

初心者
歓迎



日本工学会
ECEプログラム認定



ハーフピッチ25nm電子線描画
画

日時

2019年7月4日(木)
13:30~16:30

場所

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)
海老名本部 (神奈川県海老名市下今泉705-1
小田急線・相鉄線・JR相模線の海老名駅から徒歩15分)

講師

黒内 正仁 (神奈川県立産業技術総合研究所 電子技術部)

実習内容

電子線描画装置によるレジストへのナノパターンの形成の実習を行います。

実習機器

- 電子線描画装置 (株)エリオニクス製 ELS-S50 †

†ミクロンサイズからナノサイズの電子線レジストパターンを形成できます。フォトリソグラフィ用マスクの作製も可能。
装置仕様、微細加工・MEMSの開発支援例はHP (https://www.kanagawa-iri.jp/bgns_gid/abtus/e2d/mems/)をご覧ください。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBOIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今回は、KISTECの設備・装置を使った実習を行います。

定員：先着5名程度 参加費：1万円(実費)

※川崎市中小企業に対する、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金の適用はございません。

主催：4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所、川崎市

共催：次世代マイクロ化学チップコンソーシアム

問い合わせ先

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部 Tel: 046-236-1500 (代表)
技術担当 平林 康男 電子技術部 /E-mail: hirabaya@kanagawa-iri.jp
事務担当 渡邊、津島 人材育成部 /E-mail: sangyoujinzai@kanagawa-iri.jp